

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



# [12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200380101425.1

[51] Int. Cl.

G07D 233/54 (2006.01)

G03F 7/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 1325477C

[22] 申请日 2003.10.1

[21] 申请号 200380101425.1

[30] 优先权

[32] 2002.10.15 [33] JP [31] 300446/2002

[32] 2002.10.18 [33] US [31] 60/419,093

[86] 国际申请 PCT/JP2003/012618 2003.10.1

[87] 国际公布 WO2004/035546 英 2004.4.29

[85] 进入国家阶段日期 2005.4.15

[73] 专利权人 昭和电工株式会社

地址 日本东京都

[72] 发明人 镰田博稔 沟达宽 大西美奈

[56] 参考文献

EP1048700A1 2000.11.2

WO03072614A2 2003.9.4

EP1031579A2 2000.8.30

JP10-253815A 1998.9.25

JP2002-139833A 2002.5.17

US3538797A 1970.10.13

EP0902327A2 1999.3.17

审查员 王莉敏

[74] 专利代理机构 北京市中咨律师事务所

代理人 林柏楠 刘金辉

权利要求书 2 页 说明书 31 页 附图 5 页

[54] 发明名称

六芳基二咪唑化合物和含有该化合物的光聚合引发剂组合物

[57] 摘要

本发明提供了下式(1)的新的六芳基二咪唑化合物: 其中每个  $R_1$  代表卤素, 且每个  $R_2$  代表任选取代的  $C_{1-4}$  烷基。本发明的六芳基二咪唑化合物可在用作抗蚀剂的可光致聚合的组合物中作为光自由基产生剂, 且以低升华的热分解产物为特征。可光致聚合的组合物可适于用作抗蚀剂或用作彩色液晶显示元件、照相机等等的彩色滤光片。

